

Eric Lavallée

Associé, agent de marques de commerce et responsable du laboratoire L³IA

Eric Lavallée est avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe Droit des affaires et dirige le Laboratoire juridique Lavery sur l'intelligence artificielle (L³IA).

Sa pratique du droit dans les domaines de la propriété intellectuelle (brevets, marques de commerce et protection des logiciels) a mené M^e Lavallée à s'intéresser particulièrement aux développements de l'intelligence artificielle au cours des dernières années.

À titre d'avocat, M^e Lavallée est régulièrement appelé à accompagner des entreprises de toutes tailles, de l'entreprise en démarrage à de grandes entreprises, dans la rédaction de contrats de licences et ententes commerciales en haute technologie ainsi que dans la mise en place de stratégies de protection et de vérification diligente de propriété intellectuelle.

Il a également développé une expertise pointue dans l'analyse des impacts juridiques quant à l'application et l'implantation de l'intelligence artificielle dans des secteurs connexes à sa pratique du droit, notamment au niveau de la protection des renseignements personnels, de la régie d'entreprise et dans le secteur du droit des affaires en général.

Expertise en nanotechnologie

Eric Lavallée détient une maîtrise en physique ainsi qu'un doctorat en génie électrique. Avant de se joindre à Lavery en 2014, il œuvrait à titre de vice-président R&D au sein d'une entreprise axée sur la recherche et le développement en nanotechnologie. Il compte à son actif quatre inventions relatives à la lithographie par faisceau d'électrons pour des applications en microélectronique :



Associé, Agent de marques de commerce et Avocat Sherbrooke

Téléphone **819 346-5712**
Télécopieur 819 346-5007
elavallee@lavery.ca

Admission au Barreau

Québec, 2010



Method of producing an etch-resistant polymer structure using electron beam lithography

Plasma polymerized electron beam resist

Fabrication of sub-micron silicide structures on silicon using resistless electron beam lithography

Fabrication of sub-micron etch-resistant metal/semiconductor structures using resistless electron beam lithography

Langues

Anglais
Français

Secteurs de pratique

Intelligence artificielle

Technologies et divertissement

Fusions et acquisitions

Régie d'entreprise

À titre de chercheur, il a également signé 15 articles scientifiques et a présenté ses travaux lors de conférences internationales aux États-Unis, en Europe et au Japon dans l'industrie des nanotechnologies.

Distinctions

En 1997, il a été décoré de la Médaille du Mérite des Gouverneurs de la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. En 2009, il s'est mérité le prix du doyen de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et le prix du Barreau du Québec.

Formation

Membre du Barreau du Québec depuis 2010

LL.B., Université de Sherbrooke, 2009

Ph.D. (génie électrique), Université de Sherbrooke, 2000

M.Sc. (physique), Université de Sherbrooke, 1996

B.Sc. (physique), Université de Sherbrooke, 1994